(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公閱番号 特開2001-326311 (P2001-326311A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

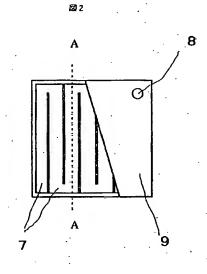
(51) Int.CI.7		F I デーマコート*(参考)		
HO1L 23/42	7	F 2 5 B 39/02	Z 3L044	
F 2 5 B 39/02	2	F 2 5 D 9/00	E 3L045	
F25D 9/00)	15/00	5 F 0 3 6	
15/00)	HO1L 23/46	Α	
		審查請求 未請求 請求	求項の数1 OL (全 4 頁)	
(21)出願番号	特顧2000-147452(P2000-147452)	(71)出額人 000005108	頭人 000005108	
		株式会社日3	立製作所	
(22)出版日	平成12年5月15日(2000.5.15)	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地		
		(72)発明者 芦分 範之		
		茨城県土浦市	卡神立町502番地 株式会社日	
		立製作所機構	就研究所内	
		(72)発明者 川村 圭三		
		茨城県土浦 7 立製作所機	市神立町502番地 株式会社日 滅研究所内	
		(74)代理人 100075096		
		弁理士 作[11 康夫	
•			最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 電子機器の冷却装置

(57)【要約】

強制流動冷却する方式の電子機器の冷却装置において、 蒸発器で取りうる熱量の限界を引き上げることである。 【解決手段】上記課題を解決するために本発明では蒸発 器内の流路に曲率をもたせた。また流路壁に微細な溝を 設け、流路壁上に液膜が保持されやすくなり、蒸発器で 取りうる熱量の限界を引き上げることができる。

【課題】モジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付けて



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体チップを搭載したモジュールに冷凍 機の蒸発器を直接取り付けて冷却する電子機器の冷却装 置において、蒸発器の底部を凹面上にし、そこに流路を 形成したことを特徴とする電子機器の冷却装置。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子計算機に用いら れる半導体素子の冷却技術の分野に属する。冷却すべき 半導体素子がCMOS素子である場合には、その性能が 10 温度によって変化することが知られている。CMOS素 子では低温化することによって動作速度が速くなるた め、チップ面上に形成された素子を低温に保ち、素子の 動作を加速することが行われている。

[0002]

【従来の技術】特開平9-139453 号公報に垂直に設置さ れた中空容器に冷媒を封入しこの中空容器の下方に半導 休素子を圧接接合し冷媒の蒸発によってこの半導休素子 を冷却する構造が開示されている。この中空容器の上方 には冷却部が設けられ、下方で蒸発した冷媒は冷却部で 20 凝縮し、重力の作用で蒸発部に戻る。即ち冷媒を強制流 動せしめる装置は存在せず、自然循環が前提である。本 従来技術では、中空容器の加熱部の幅を上方ほど広くす る構造が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年のLSIチップに はCMOS素子が用いられ、従来のバイボーラ素子を用 いた場合に比べ、発熱量は一旦減少した。 しかしなが ら、素子の高集積度化と動作周波数の増大によって、L SIチップ当たりの発熱量は再び急上昇し始め、このよ うなしSIチップを搭載したモジュールも大発熱量化し つつある。

【0004】モジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付 けて強制流動冷却する方式の電子機器の冷却装置は大発 熱量のモジュールを低温に冷却するのに適しているが、 電子計算機の場合、実装のコンパクト性が強く要求され るため、蒸発器の大きさはモジュールと同程度の大きさ に制限される。このような小形の蒸発器で取りうる熱量 には沸騰現象や冷媒の乾きによる限界があると考えら れ、モジュールの大発熱量化に対応するためには、この 40 限界を引き上げることが極めて重要な課題となる。

【0005】従来の技術は自然循環落発による冷却技術 であり、強制流動蒸発による大発熱量のモジュールの冷 却方法に関しては配慮されていない。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明では、モジュールに直接取り付ける蒸発器の 底部を凹面上にし、そこに流路を形成した。また、流路 壁に微細な溝を形成した。

[0007]

【発明の実施の形態】図1に、半導体チップを搭載した モジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付けて冷却する 電子機器の冷却装置の構成を示す。蒸発器1,圧縮機 2.凝縮器3及び減圧装置4から成る冷凍機の蒸発器1 が、半導体チップを搭載したモジュール5に熱伝導グリ ース6等を介して直接取り付けられる。 モジュールちは 蒸発器 1 内で蒸発する冷媒が蒸発潜熱を奪うことにより 冷却される。電子計算機の場合、実装のコンパクト性が 強く要求されるので、蒸発器の大きさはモジュールと同 程度の大きさに制限される。

【0008】図2及び図3に本発明の一実施例をしめ す。蒸発器は冷媒を流すための流路7、及び、冷媒を供 給,排出するための管8(一方のみ図示)及びカバー9 から成る。図3は図2におけるA-A断面図を表してい る。蒸発器底部10は凹面になっており、そこに流路7 が形成されている。即ち、流路7はある大きさの曲率を 有している.

【0009】次に本実施例の作用を説明する。冷媒は流 路内を蒸発しながら二相流の状態で流れ、蒸発器内の二 相流の流動様式は大部分の領域で、流路壁に液膜が存在 し中心部を蒸気が流れるいわゆる環状流となる。この場 合、特に流路の下流部の蒸気流速の大きい領域で液膜が 破断して微細な液滴が蒸気とともに流れる噴霧流が出現 しやすくなり、流路壁が乾き、蒸発器の底部の温度が急 **激に上昇する限界熱流束現象が発生しやすくなり、蒸発** 器で取りうる熱量に限界が生じる。

【0010】本実施例では、流路7に曲率を持たせたた め、二相流に遠心力が作用し、液膜を流路底に押し付け る降下が生じ、液膜が破断しにくくなるため、限界熱流 東現象が発生しにくく、蒸発器で取りうる熱量を引き上 げることができるという作用効果がある。

【0011】図4に本発明の他の実施例を示す。流路7 の壁面上に微細な溝11を形成したものである。 本実施 例によれば、第1の実施例の遠心力の効果に加えて、表 面張力による液膜保持作用があるので、蒸発器で取りう る熱量の限界をさらに引き上げることが可能になる。

[0012]

【発明の効果】本発明では、モジュールに直接取り付け られる蒸発器内の流路に曲率をもたせた。これによって 冷媒二相流に遠心力が作用するようにしたから限界熱流 束現象が発生しにくく、蒸発器で取りうる熱量の限界を 引き上げることができる。また、流路壁面上に微細な溝 を形成したから、表面張力が作用し液膜の保持が容易に なり、蒸発器で取りうる熱量の限界をさらに引き上げる ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例である半導体チップの冷却シス テムを示す構成図。

【図2】本発明の一実施例の平面図。

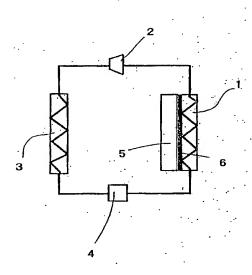
【図3】本発明の一実施例の断面図。

【図4】本発明の他の実施例の断面図。 【符号の説明】

1…蒸発器、2…圧縮機、3…凝縮器、4…減圧装置、

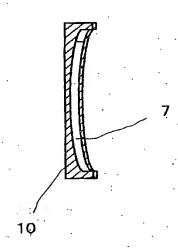
【図1】

図1



【図3】

図3

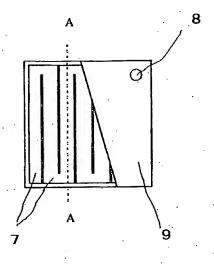


5…モジュール、6…熱伝導グリース、7…流路、8…

管、9…カバー、10…蒸発器底部、11…微細溝。

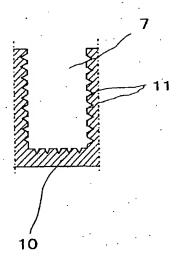
[図2]

図2



[図4]

図4



フロントページの続き

Fターム(参考) 3L044 AA04 BA06 CA14 DD07 FA04 KA04 KA05 3L045 AA04 AA06 BA04 DA02 GA05 HA01 PA04 5F036 AA01 BA08 BA23 BB53 PAT-NO: JP02001326311A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001326311 A

TITLE: COOLING DEVICE FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

PUBN-DATE: November 22, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY
ASHIWAKE, NORIYUKI N/A
KAWAMURA, KEIZO N/A

INT-CL (IPC): H01L023/427, F25B039/02, F25D009/00, F25D015/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To relax the limit amount of heat that can be taken by an evaporator in the <u>cooling</u> device of <u>electronic</u> equipment in a system for performing forced flow <u>cooling</u> by mounting the evaporator of a refrigerating machine to a module directly.

SOLUTION: A <u>channel</u> in the evaporator is allowed to have curvature. Also, by providing a fine groove on a <u>channel</u> wall, a liquid film can be retained on the <u>channel</u> wall easily, and the limit amount of heat that can be taken by the evaporator can be relaxed.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

5/16/05, EAST Version: 2.0.1.4

THIS PAGE BLANK (USPTO)